



Einladung  
Zum Workshop  
**Nanoimprint Technology**

24. Mai 2007 in Wetzlar

Für die lithographische Herstellung von Strukturen kleiner 100 nm stehen heute teure EUV-Lithographieverfahren zur Verfügung. Die Entwicklung einer neuen Lithographie-Generation für Strukturen kleiner 100 nm beschäftigt deshalb die Industrie. Hochgenaue Massenfertigung zu möglichst geringen Kosten ist das Ziel. Die Nanoimprint-Technologie bietet die Möglichkeit, Komponenten mit optischen und photonischen Strukturen, MEMS/NEMS, kleine Displays und Verbindungshalbleiter kostengünstig zu reproduzieren.

Namhafte Wissenschaftler und Ingenieure aus Hochschule und Industrie werden die Grundlagen und Anwendungen der Nanoimprint-Technologie vorstellen und die Möglichkeiten und Grenzen bezüglich Anwendungen in den optischen Technologien aufzeichnen.

**Veranstaltungsort:**

Zentrum für High Tech und Kultur – Ernst Leitz Saal  
Steinbühlstraße 15 C  
35578 Wetzlar

**Wissenschaftliche Leitung:**

Prof. Dr. Theo Tschudi, TU Darmstadt

## Programm

**09.00 Anmeldung**

**09.30 Begrüßung und Eröffnung**

*Prof. Theo Tschudi, TU Darmstadt*

**09.45 Übersicht Nanoimprint-Technologie**

*Prof. Hella-Christin Scheer, Universität Wuppertal*

**10.30 Maskenschreiben, Lithographieprozesse, Formherstellung**

*N.N.*

**11.00 Kaffeepause**

**11.30 Nanoimprint Resiste und ORMOCER®e**

*Dr. Marco Vogler, micro resist technology, GmbH, Berlin*

**12.00 Fabrication of nanoimprinted polymer photonic devices and 3D polymer structures**

*Prof. Clivia Sotomayor, Tyndall National Institute, Cork, Ireland*

**12.30 Diffraction, applications and marketing potentials**

*Dr. Lingli Wang, Philips Lighting, Eindhoven*

**13.00 Mittagspause**

**14.00 Effektive Medien - Herstellung und Applikation**

*Dr. Ernst-Bernhard Kley, Universität Jena*

**14.30 Nanoimprint Technologie**

*Lars Kock, AMO GmbH, Aachen*

**15.00 Kaffeepause**

**15.30 Replizierte Mikrooptik für Spektrometer und abbildende Systeme**

*Dr. Robert Brunner, Carl Zeiss AG, Jena*

**16.00 Bragg Gitter für Sensoranwendungen**

*Dr. Manfred Rothardt, IPHT, Jena*

**16.30 Nanoimprint Anwendungen**

*Paul Lindner, EV Group, Österreich*

**17.00 Ende der Veranstaltung, Gelegenheit für weitere persönliche Diskussionen**

## ANMELDUNG PER FAX 06732 - 935123

### Anmeldung bitte bis zum 11. Mai 2007

Stornierungen bis zum Anmeldeschluss sind kostenlos. Danach berechnen wir 10% der Teilnahmegebühr als Stornokosten. Bei Nichterscheinen trotz Anmeldung wird der volle Teilnahmebetrag fällig.

( ) Ja, ich möchte am Workshop „Nanoimprint Technology“ teilnehmen.

---

Name

---

Firma

---

E-Mail

---

Strasse

---

Ort

### Teilnahmegebühr:

( ) 110 €

( ) 80 € für Mitglieder der regionalen Kompetenznetze für Optische Technologien

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Im Preis enthalten sind Mittagessen, Kaffeepause, Pausengetränke sowie eine Kursdokumentation. Bei Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung.

Anmeldungen sind auch im Internet unter [www.optence.de](http://www.optence.de) oder per e-mail an [reuter@optence.de](mailto:reuter@optence.de) möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. (06732) 935122.